



国际先进光刻技术研讨会邀请函

International Workshop on Advanced Patterning Solutions Invitation Letter

光刻是集成电路制造领域的关键技术之一，也是衡量产业发展水平的重要指标。为了加强光刻技术领域的交流，促进业内合作，开拓研发思路，解决技术难题，推动行业发展，拟定于**2021年12月12-13日**在广东佛山举办第五届“国际先进光刻技术研讨会 (International Workshop on Advanced Patterning Solutions)”。会议将集中研讨先进光刻技术的热点问题，在浸没式，极紫外 (EUV) 光刻工艺，仿真，材料，测试，设备，设计优化等方面为大家提供技术研讨和交流的平台。本次会议仍将是一次高水平的国际技术研讨会，会议的详细信息请参见会议官网 www.iwaps.org。

本次会议的发言人来自国内外业界的顶级专家。本次会议得到了国内外知名企业、研究机构 and 高校的大力支持。

我们很荣幸地邀请您参加本次大会。

会议相关事项：

1. 会议时间：2021年12月12-13日。
2. 会议地点：广东省佛山市希尔顿酒店（广东省佛山市禅城区岭南大道北127号）。
3. 注册费用：2400元/人，集成电路产业技术创新联盟成员单位1800元/人，学生1200元/人。9月30日前注册费：2000元/人。
(会议延期前以早鸟价缴费后退费的，再次缴费仍享受早鸟价)
4. 会议详情请及时登录本次会议官方网站，并请随时留意最新会议日程 (www.iwaps.org)。
5. 可使用微信扫码  二维码进行报名。

期待您的莅临！

IWAPS 组委会

